

**(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international**



PCT



(43) Date de la publication internationale
12 janvier 2006 (12.01.2006)

(10) Numéro de publication internationale
WO 2006/003322 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
C23C 14/48, H01J 37/32, C23C 8/36

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2005/001468

(22) Date de dépôt international : 14 juin 2005 (14.06.2005)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0406496 16 juin 2004 (16.06.2004) FR

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) : ION
BEAM SERVICES [FR/FR]; ZI Peynier-Rousset, Rue
Gaston Imbert prolongée, F-13790 Peynier (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (*pour US seulement*) : TORRE-
GROSA Frank [FR/FR]; Les Putis, F-13109 Simiane
(FR). MATHIEU Gilles [FR/FR]; Le Crinas, Bâtiment B,
19, rue Paul Oducciori, F-13007 Marseille (FR). ROUX

Laurent [FR/FR]; 237, avenue de Château-Gombert, Les Informelles, F-13013 Marseille (FR).

(74) Mandataire : RENAUD-GOUD Conseil; 5, rue de Montigny, F-13100 Aix en provence (FR).

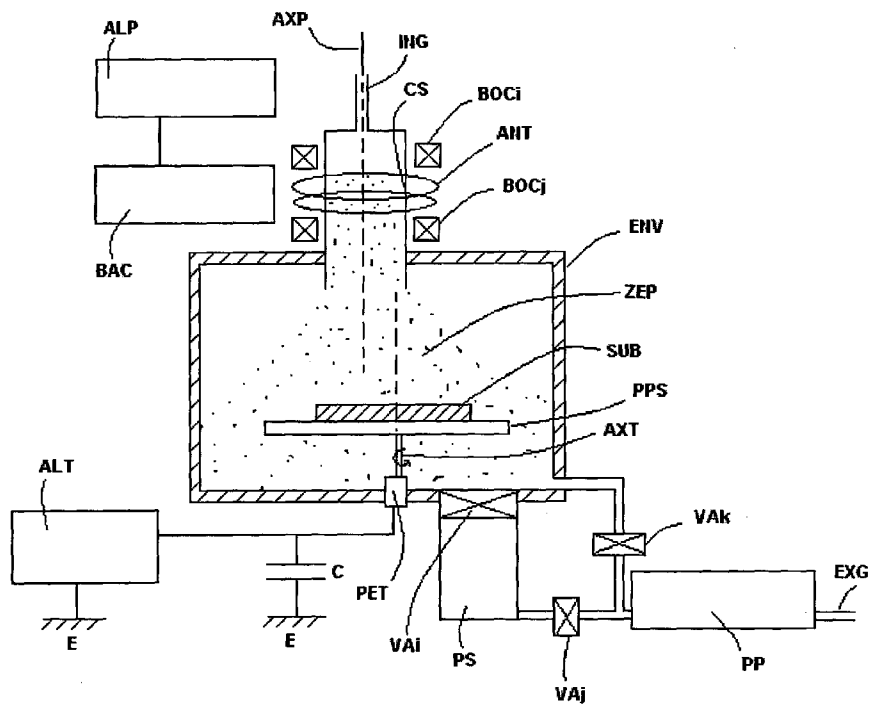
(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **États désignés** (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: ION IMPLANTER OPERATING IN PULSED PLASMA MODE

(54) Titre : IMPLANTEUR IONIQUE FONCTIONNANT EN MODE PLASMA PULSE



(57) Abstract: The invention relates to an ion implanter (IMP) comprising a pulsed plasma source (SPL), a substrate support plate (PPS) and a power supply (ALT) for said plate. The inventive implanter also comprises a capacitor C which is connected directly to the earth (E) and which is mounted downstream of the plate power supply (ALT). The invention also relates to a method of using said implanter.

[Suite sur la page suivante]

WO 2006/003322 A2



européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée :

- *sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport*

(57) Abrégé : La présente invention concerne un implanteur ionique IMP qui comporte une source plasma pulsée SPL, un plateau porte-substrat PPS et une alimentation ALT de ce plateau. Cet implanteur comporte de plus une capacité C reliée directement à la masse E et montée en aval de l'alimentation plateau ALT. L'invention vise également un procédé de mise en oeuvre de l'implanteur.